(9) 日本国特許庁(JP)

◎ 公開特許公報(A) 平1-193463

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成1年(1989)8月3日

F 16 J 15/10 C 23 C 14/56 16/50 H 01 L 21/302

C -7526-3 J 8520-4 K 7217-4 K

B-8223-5F審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

60発明の名称

真空加工装置の真空シール部構造

②特 願 昭63-19880

②出 願 昭63(1988) 1月29日

720発 明 者

池田

種 次 郎

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

⑦出 願 人 松下電器産業株式会社

個代 理 人 弁理士 森本 義弘

职 紐 書

1. 発明の名称

直空加工装置の真空シール部構造

- 2 特許請求の範囲
 - 1. 真空楷内に高周波印加部を持つ真空加工装置の真空シール部構造であつて、導配性を有しかつ弾性体である O リングを真空シール部の全周にわたつて設けた真空加工装置の真空シール部構造。
- 3. 発明の詳細な説明

産薬上の利用分野

スパッタリング、プラズマCVD、プラズマアッシャ、イオンプレーテイング、イオンガンなどの高周波プラズマ放電や高周波溶解炉などの、真空波圧雰囲気中に高周波印加部を有する真空加工装置に関するもので、特にその真空シール部に係るものである。

従来の技術

大阪府門真市大字門真1006番地

従来、高周波を用いる真空加工装置において、 その真空シールには、第2図または第3図に示す ように、ゥレタンやフッ語樹脂などからなる弾力 11 性を有するOリングが用いられている。しかし、 これらの0リング11を用いたものでは、真空槽 のリング (1を通して 内の高周波印加部から高周波電波が減れ、真空加 工裝置の他の機器、たとえば真空計などにノイズ として悪影響を及ぼすことが多い。特に高周波パ ワーが大きくなると、回路的に防ぎようが無くな り、正しい真空度が計測できないばかりか、制御 系にもノイスが乗り誤動作することがあつた。そ のため、これらの装置では第2回に示すように、 高周波電波シールド用の金属メツシュリング12 を別途取付けるが、第4図に示すようにくし型の 金履片の下部を折曲して形成した接触片13を第 3 図に示すように真空加工装置に取付ける方法、 もしくは真空シール後にシール箇所前後の2つの 部位をSUSポルトやコの字型治具で締付けて固 定する方法を用いていた。

発明が解決しようとする課題

ところで、この種の真空加工装置の真空シール 部においては、たとえば真空槽の蓋部のように、 蒸材の出入れ、材料の交換、メンテナンスなどで しばしば開閉する部所では、開閉が容易な金属メ ツシュリング12やくし型接触片13を用いる必 要がある。しかしながら、特にこれら金属メッシュ リング12やくし型接触片13を用いる方法では、 真空シール用Oリング以外にこれら部品を取付け なければならず、金属メッシュリング12を用い る場合では、リング欝加工が必要となるとともに、 金属メッシュリング12が蓋の開閉時に浮き上が ることがあり、自動装置などでは、毎回人の確認 が必要となるなど問題があつた。また、くし型接 触片13を用いる場合は、燐背銅や真鍮を用いる が、繰り返し変形によりその弾力性を失い、永久 変形してしまい、シールド効果が不安定となつて 取換えが必要となるとともに、くし型接触片13・ が折れ込んで真空シール不良やリークの原因とな ることもあつた。さらに、これら金属メッシュリ

作用

上記樹成により、弾性体であるOリングにより 真空が保たれると同時に、このOリングは導電性 であるので、真空やール部が全周にわたの漏れはでいたされ、真空槽内からの高周波配改の漏れははいいではない。この体積抵抗値が5gaより大ないののリングは、その体積抵抗値が5gaより大ないれる場合があるため、体積抵抗値が5gaは以下のOリングを用いて高周波の漏れを完全に防止する。 実施例

以下、本発明の一実施例を図面に基づき説明する。

第1図は本発明の一実施例を示す真空加工装置の真空シール部の断面図である。第1図において、1は真空槽2の下チャンパ・3は真空槽2の蓋で、下チャンパ1にはその外周側に延びるファンジ部1aに溝1bが全周にわたつて形成され、この溝1bの中には0リング4が嵌装されている。この0リング4はフッ素樹脂製ゴムにカーボンを配合

ング12またはくし型接触片13のいずれを用いる場合でも、その取付け部は0リング11の外側に必要であり、その面積分だけ真空加工装置が大きくなり、また、これらの場合にはリング海の加工分や、金属メッシュリング12あるいはくし型接触片13の取付部品分だけ真空加工装置が高価となる。

本発明は上記問題を解決するもので、真空槽内に高周波印加部を有する真空加工装置において、特別の加工分や余分の取付部品分を必要とせずに、高周波電波漏れを防止することが可能であり、構造簡単かつ安価にできる真空シール部構造を提供することを目的とするものである。

課題を解決するための手段

上記問題を解決するために本発明は、真空シール用のOリングとして、専電性のあるかつ弾性体である材料を用い、このOリングを真空シール部の全周にわたつて設けたものである。

さらには、Oリングとしては体積抵抗値が5gcx以下のものを用いるものである。

したり、金属粉を混ぜ合わせたりしたもので、ゴムとしての弾性を失うことなく、しかも導電性とされている。この〇リング4の体積抵抗値は5gの其空槽2の中には高周波電波を発生する高周波印加部(図示せず)が備えられている。

 たれ、高周波電波の漏れの防止を確認できた。

なお、Oリング4にあまり弾性を有しない金属パイプリングを用いると、その価格が高いだけでなく、繰り返し寿命が極端に短かく、さらに金属パイプリングの大きさに合わせてシール部を形成しなければならないなどの問題があり、Oリング4の材料としては不適当である。

発明の効果

 どのおそれなく高周波配波の漏れを確実に防止で きる。

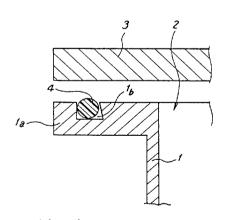
4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例を示す真空加工装置の真空シール部の断面図、第2 図および第3 図は従来の真空加工装置の真空シール部の断面図、第4 図は従来の真空加工装置のくし型接触片の折曲げ工程図である。

1 …下チャンパ、1 a …フランジ部、1 b … 游、 2 …真空槽、3 … 蓋、4 … O リング。

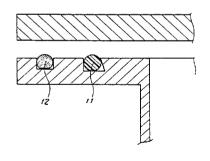
代理人 森本義弘

第 / 図

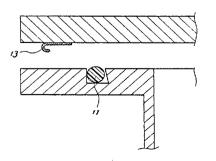


1…Ffャンバ 1a…フランジ部 1b…溝 2…真空槽 3…蓋 4…Oリング

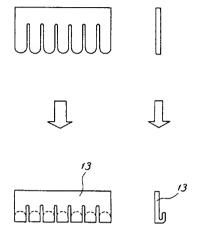
第 2 図



第3図



第4図



PAT-NO: JP401193463A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01193463 A

TITLE: VACUUM SEAL STRUCTURE OF

VACUUM WORKING DEVICE

PUBN-DATE: August 3, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

IKEDA, TANEJIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD N/A

APPL-NO: JP63019880

APPL-DATE: January 29, 1988

INT-CL (IPC): F16J015/10 , C23C014/56 ,

C23C016/50 , H01L021/302

US-CL-CURRENT: 118/733 , 204/298.02

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent high frequency electric wave from leakage economically with a simple structure by using a conductive elastic body for a vacuum sealing O-ring to provide the O-ring having the volume resistance value less than a specified value over the whole periphery of a vacuum sealing portion.

CONSTITUTION: In operating a vacuum working device, a lid 3 covers the upper surface of a flange 1a of a chamber 1 so that an O-ring 4 fitted in a groove 1b of the flange 1a of the lower chamber 1 is positioned in intimate contact with the lower surface of lid 3. Thus, a vacuum tank 2 is sealed completely from the outside to maintain the vacuum condition. Also, high frequency electric waves from a high frequency applying section in the vacuum tank 2, while the high frequency electric waves are not leaked from a sealing portion of the vacuum working device since the conductive O-ring 4 is disposed over the whole periphery of said sealing portion. When the O-ring 4 here has the volume resistance value less than 5Ω cm, the shield property can be maintained to prevent the high frequency electric waves from leakage.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio